

(参考)特許料等の減免措置一覧(2006年4月現在)

対 象	措 置 内 容		
	出願日 ~ H16.3.31	H16.4.1~H19.3.31	H19.4.1~
国	免除 (特許法第107条、195条)		
国立大学法人 大学共同利用機関法人 (独)高等専門学校		免除 (産業技術力強化法附則第3条)	審査請求料:半額軽減 特許料1~3年分:半額軽減 (産業技術力強化法第16条)
国立大学 認定TLO	免除 (改正法*1附則第8条)		
国立大学法人 承認TLO		免除 (TLO法*2附則第3条)	審査請求料:半額軽減 特許料1~3年分:半額軽減 (産業再生法第32条、33条)
大学等 承認TLO	審査請求料:半額軽減 特許料1~3年分:半額軽減 (産業再生法第32条、33条)		
試験研究型独立行政法人 認定TLO	免除 (改正法附則第8条)	審査請求料:半額軽減 特許料1~3年分:半額軽減 (TLO法第13条)	
国立試験研究機関 認定TLO	免除 (TLO法第13条)	免除 (TLO法第12条)	
独立行政法人 (H16.3.31時点で特許法施行 令に指定されているもの)	免除 (改正法附則第2条4項)		
独立行政法人 (産業技術力強化法施行令に 指定されているもの) *3		審査請求料:半額軽減 特許料1~3年分:半額軽減 (産業技術力強化法第16条)	
資力に乏しい個人	審査請求料:免除、半額軽減, 実用新案技術評価請求料:免除、半額軽減 特許料1~3年分:免除、3年間猶予, 実用新案登録料1~3年分:免除、3年間猶予 (特許法第109条、195条の2), (実用新案法第32条の2、54条)		
資力に乏しい法人	審査請求料:半額軽減 特許料1~3年分:3年間猶予 (特許法第109条、195条の2)		
アカデミック・ディスカウント (大学等、大学等の研究者)	審査請求料:半額軽減 特許料1~3年分:半額軽減 (産業技術力強化法第16条)		
研究開発型中小企業	審査請求料:半額軽減 特許料1~3年分:半額軽減 (産業技術力強化法第17条)		
公設試験研究機関等 *3		審査請求料:半額軽減 特許料1~3年分:半額軽減 (産業技術力強化法第16条)	

(注)上記の減免措置は、特許について対象としており、実用新案(資力に乏しい個人を除く)、意匠、商標については対象外となります。

*1 改正法:特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)

*2 TLO法:大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転に関する法律

*3 産業技術力強化法第16条に基づく「独立行政法人」及び「公設試験研究機関等」に対する減免措置の適用は、平成16年4月1日以降の手續から対象